

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成24年1月5日(2012.1.5)

【公表番号】特表2011-511996(P2011-511996A)

【公表日】平成23年4月14日(2011.4.14)

【年通号数】公開・登録公報2011-015

【出願番号】特願2010-539696(P2010-539696)

【国際特許分類】

H 05 F 3/06 (2006.01)

【F I】

H 05 F 3/06

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月10日(2011.11.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

誘電材料上の電荷を変更するための電荷変更システムであって、前記システムが、前記誘電材料に隣接する場所にガスを導入して、前記ガスが前記場所で、大気中におけるよりも高い濃度を有するようにするためのガス源と、

紫外線を発生させると共に、前記紫外線を前記場所に方向付けるための紫外線源であって、前記紫外線は前記ガスと前記誘電材料との境界面に供給され、前記紫外線が前記ガス及び前記誘電材料と相互作用して、前記誘電材料上の電荷を変更する、紫外線源と、を備える電荷変更システム。

【請求項2】

誘電材料上の電荷を変更する方法であって、前記方法が、前記誘電材料を得る工程と、

前記誘電材料に隣接する領域にガスを導入して、前記ガスが前記領域で、大気中におけるよりも高い濃度を有するようする工程と、

前記領域及び前記誘電材料に紫外線を照射する工程であって、該紫外線は前記ガスと前記誘電材料との境界面に供給される工程と、

前記誘電材料に照射を行いながら、前記誘電材料上の電荷を変更する工程と、を含む方法。

【請求項3】

誘電材料を受け入れるための誘電材料経路と、

ガスを含むガス源であって、前記ガス源が、前記誘電材料経路に隣接する場所に前記ガスを供給して、前記場所における前記ガスの濃度を上昇させるように配置された、ガス源と、

前記場所に紫外線を照射して、前記ガスを励起させると共に、前記誘電材料上の電荷を変更するための紫外線源であって、前記紫外線は前記ガスと前記誘電材料との境界面に供給される、紫外線源と、を備える電荷変更システム。